

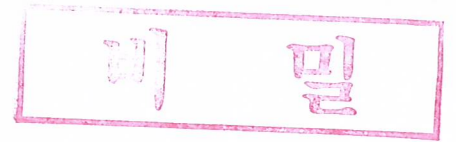
수정계약서

경기도 화성시 반월동 산 16번지에 주사무소를 두고 있는 삼성전자 주식회사 (이하 "삼성전자"라 칭함) 와 경기도 평택시 지제동 33번지에 주사무소를 두고 있는 아이피에스 주식회사("아이피에스")는, D50급 이하 Capacitor 공정개발에 필요한 High-K 유전막 개발을 위해 2004년 12월 10일자로 체결한 공동개발 계약서 (이하 "원 계약서")에 대해 수정계약을 체결하고자 한다.

1. 삼성전자와 아이피에스는 원 계약서 상의 개발 목적을 위해 추가로 SrTiO_3 , BaSrTiO_3 유전막 개발 및 증착 공정 확보를 위해 공동개발을 추진하도록 한다.
2. 삼성전자와 아이피에스는 본 공동개발을 완료하기 위해 개발기간 및 계약기간을 2005년 11월 10일에서 2006년 11월 10일까지로 연장하고자 한다.

분기	1/4			2/4			3/4			4/4		
Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
설비 set-up												
ALD 공정 TEST												
S/C 평가												
신뢰성 평가												
증착 속도 평가												

3. 본 수정계약서에서 언급된 이외의 조항들은 원 계약서를 따른다.



삼성전자 주식회사

서명 : Chunjin

성명 : 정 우 인

직위 : 연구임원

날짜 : 2006. 2. 22

아이피에스 주식회사

서명 : 이 가 훈

성명 : 이 가 훈

직위 : 이사

날짜 : 2006. 2. 3